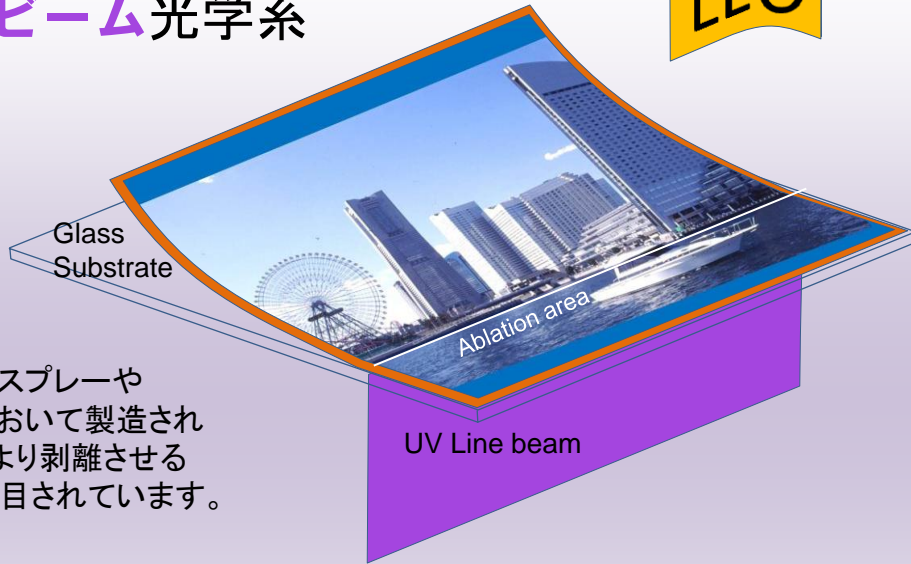


大面積のレーザーリフトオフ のための紫外ラインビーム光学系



INNOVAVENT®
VOLCANO 50UV



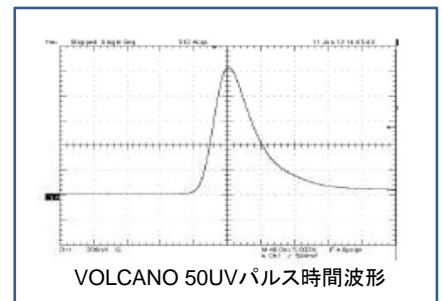
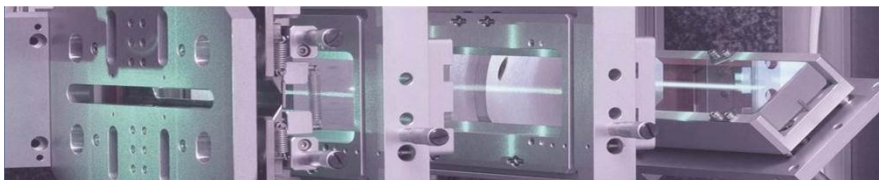
近年フレキシブルのフラットパネルディスプレイや大型ウエハ上での半導体プロセスにおいて製造されたデバイスを基板の裏からレーザーにより剥離させるレーザーリフトオフ・プロセス(LLO)が注目されています。

ガラス基板などレーザーを透過する基板を用いてアブレーション加工出来るものであれば界面に発生する応力より空気中の加工より容易に剥離が可能です。

従来のLED製造におけるGaNのリフトオフではダイサイズが比較的小さいく小面積の均一ビームの照射で十分でした。

FPD用途では全域をリフトオフする必要がありラインビームによるプロセスが有効になります。

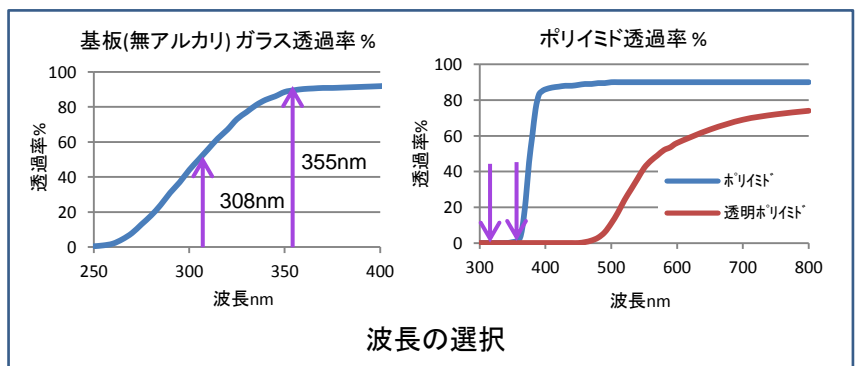
VOLCANO 50UV / LB 365 は高出力紫外レーザーを用いてFPD基板ボトムの有機膜を高スループットでリフトオフするために必要な紫外ラインビームを提供します。



紫外ラインビームタイプ

VOLCANO 50UV
ライン長さ 50 mm

VOLCANO LB 365UV
ライン長さ365 mm



■ お問い合わせ
株式会社オプトピア
TEL 044-812-5911
sales@optopia.co.jp

